

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DE 00/2797

PRIORITY
DOCUMENTSUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

REC'D 24 OCT 2000

WIPO

PCT

Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung

10/018904

Aktenzeichen:

199 44 857.4

Anmeldetag:

18. September 1999

Anmelder/Inhaber:

CEOS Corrected Electron Optical Systems GmbH,
Heidelberg/DE

Bezeichnung:

Elektronenoptische Linsenordnung mit weit
verschiebbarer Achse

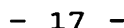
IPC:

H 01 J, G 03 F

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der
ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.München, den 12. September 2000
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Eber!





THE UNIVERSITY OF CHICAGO

100813701

30

P A T E N T A N S P R Ü C H E

=====

5

10

15

20

25

30

1. Elektronenoptische Linsenordnung mit weit verschiebbarer Achse, insbesondere für die Elektronenlithographie, mit einer Zylinderlinse (6) und einem Quadrupolfeld, dessen Symmetrieebene in der Mittelebene des Spaltes der Zylinderlinse (6) verläuft, wobei die fokussierende Ebene des Quadrupols in Richtung des Spaltes ausgerichtet ist und die fokussierende Brechkraft der Zylinderlinse betragsmäßig doppelt so groß wie die des Quadrupols ist, **dadurch gekennzeichnet, daß**

- ein Ablenksystem (4, 5) für die geladenen Teilchen in der Ebene des Spaltes der Zylinderlinse (6) vorgeschaltet ist und

- in Richtung des Spaltes der Zylinderlinse (6) mehrere, ein Quadrupolfeld erzeugende Elektroden bzw. Polschuhe vorhanden sind, die individuell und vorzugsweise sukzessive erregbar sind und

- das Quadrupolfeld entsprechend der Ablenkung des Teilchenstrahles derart verschoben wird, daß der

Teilchenstrahl im Bereich des Quadrupolfeldes auftrifft sowie

- eine Halterung für das Objekt (9) vorhanden ist, die senkrecht zur optischen Achse und zur Richtung des Spaltes der Zylinderlinse (6) verschiebbar ist.

2. Linsenordnung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet,**

zeichnet, daß das Zylinder- (6) und/oder Quadrupol-
feld elektrisch sind.

5

3. Linsenordnung nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Mittelektrode (7) der Zylinderlinse (6) in Richtung des Spaltes in einzelne elektrisch gegeneinander isolierte Bereiche unterteilt ist, die individuell ansteuerbar sind (Kammlinse).

10

15

4. Linsenordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Felder symmetrisch zur Mittelebene der Linse verlaufen.

20

5. Linsenordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **gekennzeichnet durch** mehrere Anordnungen in Richtung des Spaltes der Zylinderlinse (6) nebeneinander und aneinander anschließend.

25

6. Linsenordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **gekennzeichnet durch** mehrere Anordnungen senkrecht zur Richtung des Spaltes übereinander.

30

7. Linsenordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Ablenk-
system aus zwei in Richtung des Teilchenstrahls hintereinander angeordneten und in gegensätzliche Richtungen ablenkenden Elementen besteht, durch die

eine achsparallele Strahlversetzung erzeugt wird.

5

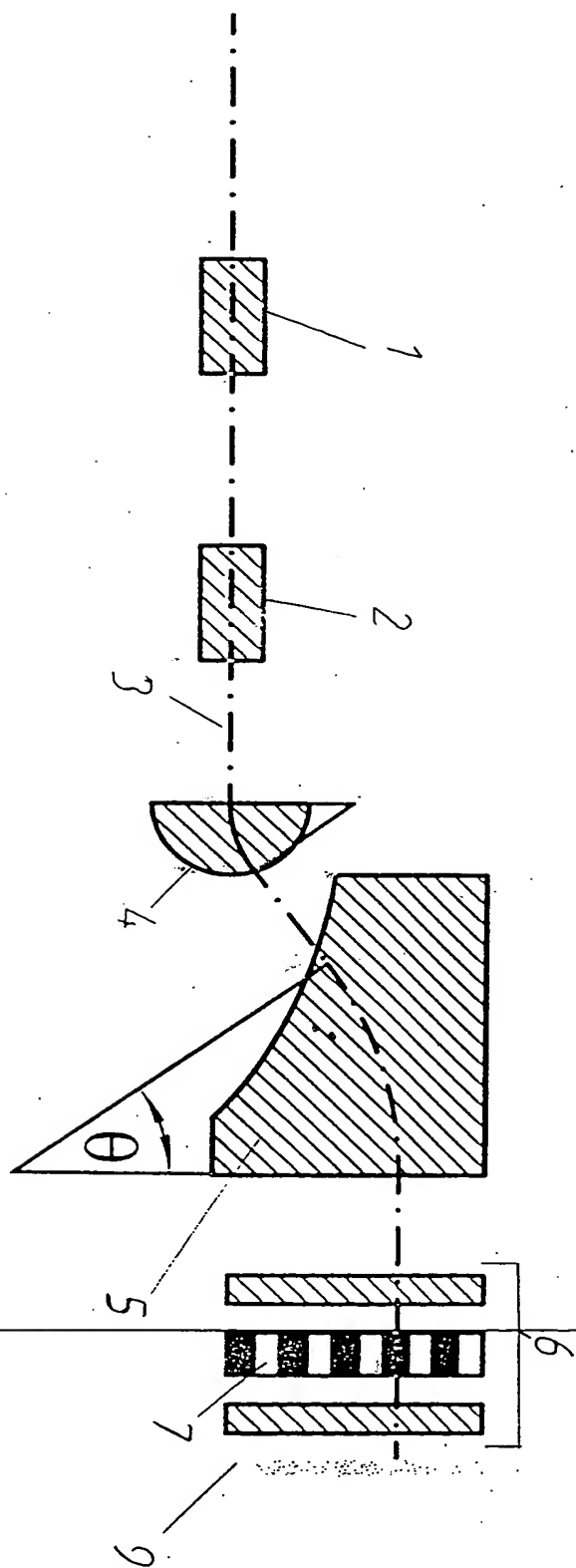
8. Linsenordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß das Abblenksystem (4, 5) aus einem statischen magnetischen (5) und einem zweiten, in Richtung des Strahleinganges vorgeschalteten zeitlich veränderlichen Magnetfeld (4) aufgebaut ist.

10

15

9. Linsenordnung nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Formung des Polschuhs des statischen Magnetfeldes (5) derart gewählt ist, daß unabhängig von der Ablenkung der austretende Teilchenstrom parallel zum einfallenden Teilchenstrom verläuft.

Fig. 1



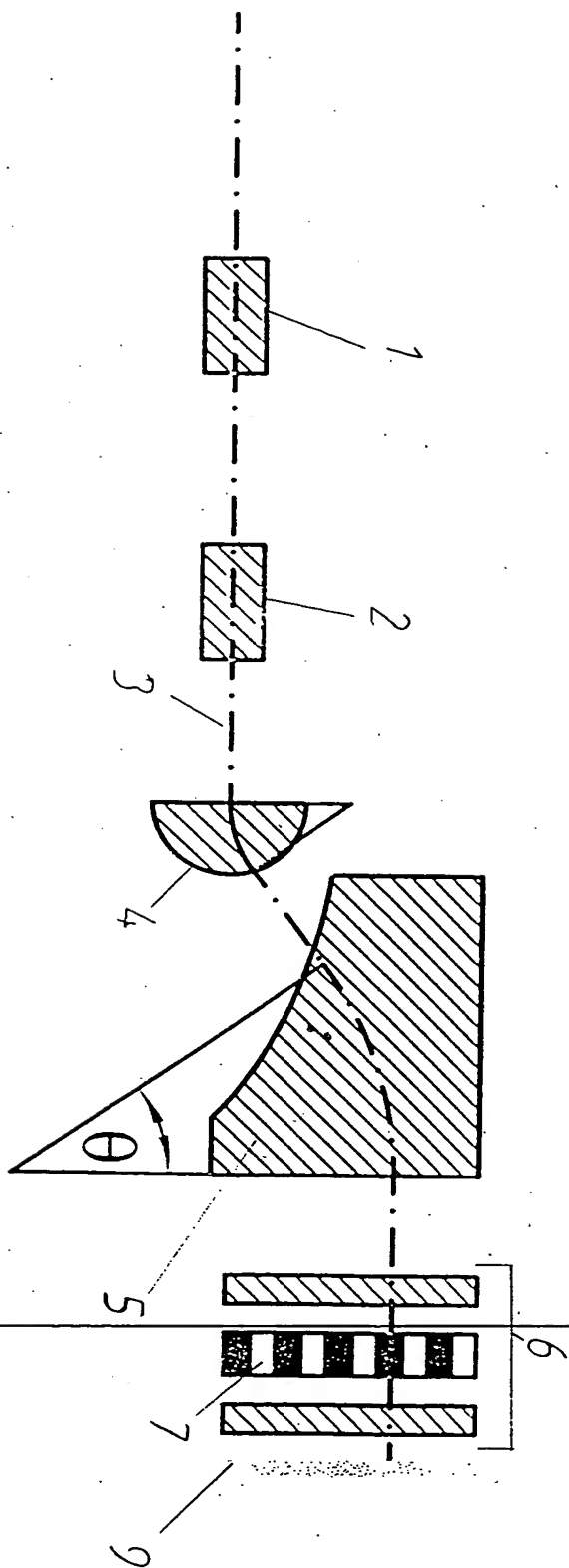
Elektronenoptische Linsenordnung mit weit ver-
schiebbarer Achse

5 Die Erfindung bezieht sich auf eine elektronenopti-
sche Linsenordnung mit weit verschiebbarer Achse,
insbesondere für die Elektronenlithographie, mit
einer Zylinderlinse und einem Quadrupolfeld, dessen
Symmetrieebene in der Mittelebene des Spaltes der
10 Zylinderlinse verläuft, wobei die fokussierende
Ebene des Quadrupols in Richtung des Spaltes ausge-
richtet ist und die fokussierende Brechkraft der
Zylinderlinse betragsmäßig doppelt so groß wie die
des Quadrupols ist,

15 Eine der Hauptanwendungsgebiete der Elektronen-
strahlolithographie ist die Herstellung elektroni-
scher Bauelemente und integrierter Schaltungen auf
der Oberfläche scheibenförmiger Halbleiterkristalle
20 (Wafer). Deren angestrebte Verkleinerung erfordert
das Schreiben von Strukturen möglichst minimaler
Größe. Der entscheidende Vorteil gegenüber der op-
tischen Lithographie besteht darin, daß die Wellen-
längen der Elektronen im Vergleich zum Licht we-
sentlich geringer sind und somit die Abbildung

25 kleinerer Strukturen erlaubt. Desweiteren besitzen
Elektronenstrahlschreiber die Fähigkeit sehr kleine
Strukturen schnell zu schreiben, haben jedoch ge-
genüber lichtoptischen Projektionen den Nachteil
30 der längeren Belichtungszeit, das Erfordernis der
Herstellung eines guten Vakuums und eines in der
Bildebene schnell und präzise bewegbaren Tisches,
wobei sich diese Forderung daraus ergibt, daß die

Fig. 1



bekannten elektronenoptischen Ablenkelemente den Strahl nur im Milimeterbereich fehlerarm auszulenken vermögen. Aus diesem Grunde wird die Elektronenstrahlolithographie bislang vor allem für die Herstellung von Masken zur optischen Lithographie und für die Herstellung von Custom Chips verwendet, bei denen die benötigte Zeit von untergeordneter Bedeutung ist.

Von Goto und Soma, veröffentlicht in der Zeitschrift "Optik" 48, 255 - 270 MOL (moving objective lense), 1977, wird der Vorschlag gemacht, einem Rundlinsenfeld Ablenkefelder zu überlagern durch die sich das Bildfeld erweitern läßt, was noch nicht ausreicht um ein Bildfeld von der Ausdehnung eines Wafers zu erhalten, so daß nach wie vor der Bohrungsdurchmesser der Rundlinse das nutzbare Bildfeld in entscheidender Weise begrenzt. Zudem ist weiterhin eine in einer Ebene senkrecht zum Elektronenstrahl zweidimensional bewegliche Werkstückhalterung erforderlich, von der die Leistungsfähigkeit des Systems und die minimale Größe der erzeugbaren Strukturen von der Bewegungsgenauigkeit abhängt und die Bewegungsgeschwindigkeit der Halterung die maximale Schreibgeschwindigkeit bestimmt.

Zur Fokussierung geladener Teilchen sind Zylinderlinsen bekannt (H. Rose, Optik 36, 1971, Seite 19 - 36), bei denen die Elektroden bzw. Polschuhe zur Erzeugung des elektrischen bzw. magnetischen Feldes eine spaltförmige Öffnung aufweisen, deren Längsachse senkrecht zur optischen Achse ausgerichtet ist, wobei diese mit der optischen Achse eine

Ebene aufspannt, die die Mittelebene der Zylinderlinsenordnung beschreibt. Eine stigmatische Abbildung ist mit Hilfe von Zylinderlinsen prinzipiell unmöglich, da lediglich senkrecht zur

5 Spaltrichtung eine fokussierende Wirkung eintritt, wohingegen die Bewegungskomponenten der abzubilden- den geladenen Teilchen parallel des Spaltes keine Ablenkung erfahren (oder umgekehrt). Die erhaltenen stabförmigen astigmatischen Punktbilder sind zur

10 Abbildung ungeeignet. Aus der PCT/DE 97/05518 ist eine elektronenoptische Linsenordnung bekannt, bei welcher die Zylinderlinse eine Quadrupolfeld überlagert und derart zugeordnet wird, daß die fokussierende Ebene des Quadrupoles in Richtung des

15 Spaltes der Zylinderlinse ausgerichtet ist und demzufolge die defokussierende Ebene senkrecht dazu bei koaxialen optischen Achsen verläuft. Demnach erfolgt die Fokussierung in der einen, der Spalten- benen durch das Quadrupolfeld und in der senkrecht

20 hierzu verlaufenden Ebene durch die Zylinderlinse, deren Stärke so einzustellen ist, daß eine Eliminierung des defokussierenden Anteiles des Quadrupolfeldes eintritt. Wird die fokussierende Wirkung in beiden senkrecht zueinander verlaufenden Ebenen

25 gleich einjustiert ergeben die Kombination der beiden Linsen stigmatische Abbildungen.

30 Hiervon ausgehend hat sich die Erfindung die Schaffung einer elektronenoptischen Linsenordnung zur Aufgabe gemacht, welche in einer Richtung einen sehr großen Arbeitsbereich aufweist und den Strahl auch in den weit von der Mitte entfernten Bereichen

im wesentlichen stets senkrecht auf das Objekt auf-
treffen läßt.

- 5 Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß dadurch,
daß ein Ablenksystem für die geladenen Teilchen in
der Ebene des Spaltes der Zylinderlinse vorgeschal-
tet ist und
- 10 - in Richtung des Spaltes der Zylinderlinse meh-
rere, ein Quadrupolfeld erzeugende Elektroden bzw.
Polschuhe vorhanden sind, die individuell und vor-
zugsweise sukzessive erregbar sind und
- 15 - das Quadrupolfeld entsprechend der Ablenkung des
Teilchenstrahles derart verschoben wird, daß der
Teilchenstrahl im Bereich des Quadrupolfeldes auf-
trifft sowie
- 20 - eine Halterung für das Objekt vorhanden ist, die
senkrecht zur optischen Achse und zur Richtung des
Spaltes der Zylinderlinse verschiebbar ist.
- 25 Der Kerngedanke der Erfindung besteht darin, der
aus Zylinderlinse und Quadrupolfeld bestehenden
elektronenoptischen Linsenordnung ein Ablenksy-
stem vorzuschalten, welches den in aller Regel aus
Elektronen bestehenden Teilchenstrahl im wesentli-
chen achsparallel und in Richtung des Spaltes der
Zylinderlinse verschiebt und das Quadrupolfeld im
Auftrittspunkt des Teilchenstrahles innerhalb der
Linsenordnung erzeugt wird. Die räumliche Ver-
schiebung des Quadrupolfeldes erfolgt auf elektro-
nischem Wege, d. h. das Quadrupolfeld wird im Be-
reich des Auftreffpunktes des Teilchenstrahles
durch Beaufschlagung der dort befindlichen Elektro-

den (bei elektrischen Linsen) oder Polschuhen (bei magnetischen Linsen) erregt. Für die konkrete bauliche Realisierung sind grundsätzlich zwei Prinzipien denkbar: Zum einen läßt sich das Quadrupolfeld diskontinuierlich in Richtung des Spaltes der Zylinderlinse sprunghaft verschieben, so daß bei stetigem Verschieben des Teilchenstrahles dieser in der Regel etwa außerhalb der Achse des Quadrupolfeldes durch die Linsenanordnung tritt. Diese geringen Abweichungen von der Achse des Quadrupolfeldes geben Anlaß zum Entstehen elektronenoptischer Bildfehler, die aufgrund der geringen Abweichungen jedoch so klein sind, daß sie die Qualität der optischen Abbildung nicht nennenswert zu beeinträchtigen vermögen. Daneben sind auch Anordnungen denkbar, bei denen synchron zur Ablenkung des Teilchenstrahles und somit kontinuierlich das Quadrupolfeld in Richtung des Spaltes der Zylinderlinse verschoben wird. Eine entsprechende Justierung läßt erreichen, daß der Teilchenstrahl exakt in der Achse des Quadrupolfeldes verläuft, so daß ein Auftreten von aufgrund des außeraxialen Durchtritts des Teilchenstrahles durch Quadrupolfeld erzeugte Bildfelder unterbleiben. Aufgrund der Tatsache, daß die Erzeugung des Quadrupolfeldes die baulich konstruktive Anordnung von Elektroden bzw. Polschuhen vorsehen, die einen Eigenplatzbedarf erfordern und demzufolge in Richtung des Spaltes der Zylinderlinse von endlicher Ausdehnung sind, erweist sich die Verschiebung des Quadrupolfeldes in infinitesimal kleinen Schritten als theoretisch erwünscht, in der Praxis jedoch nur als approximierbar. Der Teilchenstrahl wird bei der vorgeschlagenen Anordnung auch in den

von der Objektmitte weit entfernten Bereichen im wesentlichen senkrecht und in unveränderter optischer Abbildungsqualität auf das Objekt auftreffen. Ohne Qualitätseinbuße ist somit eine Verschiebung des Teilchenstromes über einen Bereich möglich, wie er durch die Breite des Spaltes der Zylinderlinse begrenzt wird. Das Ergebnis ist, daß sich eine exakte optische Abbildung entlang einer in Richtung des Spaltes der Zylinderlinse verlaufenden Geraden vornehmen läßt. Die durch die Bohrung der Rundlinsen bedingte Einschränkung des Bildfeldes entfällt.

Gegenüber den bisherigen Anordnungen der Elektronenlithographie zum Beschreiben des Objektes, bei denen eine zweidimensionale Verschiebung senkrecht zum Elektronenstrahl auf mechanischem Wege unabdingbar war, was bekanntlich eine erhebliche Einschränkung der Leistungsfähigkeit zur Folge hat, ist das Objekt nunmehr noch in einer Richtung senkrecht zum Spalt der Zylinderlinse, jedoch weiterhin in einer senkrecht zur optischen Achse verlaufenden Ebene und demzufolge nur noch eindimensional zu verschieben. Eine eindimensionale Verschiebung zudem bei geringerer Geschwindigkeit läßt ein wesentlich präziseres Arbeiten zu.

Die Benutzung geschieht im wesentlichen in an sich bekannter Weise indem das Objekt, bei dem es sich im Falle einer Elektronenlithographie häufig um einen Halbleiterwafer handeln wird, eindimensional senkrecht zur optischen Achse und auch zum Spalt der Zylinderlinse mechanisch verschiebbar fixiert wird. Senkrecht hierzu erfolgt das Beschreiben

durch den Teilchenstrahl mit Hilfe der vorbeschriebenen elektronenoptischen Linsenordnung in einem sehr langen linienförmigen Bereich, der in Richtung des Spaltes der Zylinderlinse verläuft und entlang dem eine gute stigmatische Abbildung aller Punkte möglich wird. Mit der vorbeschriebenen Anordnung kann bei einer Auflösung von 0,025 Mikrometer und einem Achsabstand von 5 mm eine verzeichnungsfreie Abbildung erfolgen. Im Ergebnis erhält man eine deutliche Vergrößerung des in Richtung des Spaltes der Zylinderlinse verlaufenden linienförmig abgebildeten Bereiches hoher optischer Qualität. Senkrecht hierzu, d. h. in Verschieberichtung des Objektes wird die Abbildungsqualität durch die Verschiebegenauigkeit der Mechanik weiterhin bestimmt, wobei darauf hinzuweisen bleibt, daß die Eindimensionalität und das langsamere Verschieben ein wesentlich präziseres Arbeiten der Mechanik zuläßt.

Im Rahmen der Erfindung steht grundsätzlich frei, ob Quadrupol- und/oder Zylinderfeld elektronisch oder magnetisch erzeugt werden. Als zweckmäßig wurde erkannt, daß Zylinder- und/oder insbesondere das zu verschiebende Quadrupolfeld elektrisch zu

wählen, weil dann unter Umgehung von Remanenzen und Wirbelströmen eine schnelle Feldverschiebung möglich ist.

Zur konkreten Realisierung des in Richtung des Spaltes der Zylinderlinse verschiebbaren elektrischen Quadrupolfeldes wird die Mittelelektrode der Zylinderlinse in Richtung des Spaltes in einzelne

elektrisch gegeneinander isolierte Einzelelektroden unterteilt, die individuell ansteuerbar sind. Zur Verschiebung und zur Erzeugung des gewünschten elektrischen Feldes werden sukzessive die Einzel-

5 elektroden unter entsprechende Spannung gesetzt. Das sukzessive Ansteuern der benachbarten Elektroden bewirkt die gewünschte Verschiebung.

Zur Reduzierung vieler, aufgrund der krummen optischen Achse hervorgerufenen Bildfehler zweiter Ordnung ist bevorzugt, die Felder und daraus resultierend die Funtamentalbahnen symmetrisch zur Mittelebene der Linse zu wählen.

10

Bislang beschrieben wurde eine Anordnung, bei der eine einzige Quelle (Elektronenquelle) den Teilchenstrahl zur Beschreibung des Objektes erzeugt und in der vorbeschriebenen Weise ablenkt. Eine wesentliche Verbreiterung des Bildfeldes in Richtung der fehlerfrei abbildenden, in Richtung des Spaltes der Zylinderlinse verlaufenden Gerade läßt sich dadurch erreichen, daß mehrere der vorbeschriebenen Anordnungen parallel zueinander und in Richtung des Spaltes der Zylinderlinse nebeneinander angeordnet werden, in der Weise, daß sich der Abbildungs-

15

20

25

reich benachbarter Anordnungen überlappt oder doch zumindest aneinander anschließt. Bei N gleichartigen Anordnungen läßt sich dann eine N-fache Bildbreite erzielen. Aufgrund der Möglichkeit des synchronen Arbeitens jeder einzelnen Anordnung verbleibt es bei der Schreibdauer, die eine Einzelanordnung benötigt.

30

Eine weitere Möglichkeit der Verkürzung der Schreibdauer läßt sich dadurch erreichen, daß mehrere der vorbeschriebenen Anordnungen senkrecht zur Richtung des Spaltes und damit übereinander angeordnet sind. Hierdurch erreicht man, daß das Objekt gleichzeitig in mehreren, in Bewegungsrichtung des Objektes hintereinander liegenden Bereichen beschrieben wird, sodaß ein Teilchenstrahl nur einen einzigen Teilbereich abzudecken hat. Die Verschiebung des Objektes hat nur so zu erfolgen, daß der Strahl nur den ihm zugeordneten Bereich abdecken muß.

Die in der Spaltebene der Zylinderlinse wirkenden und diesen vorgeschalteten Ablenkssysteme sollen ein möglichst senkrechtetes Auftreffen auf das Objekt sicherstellen, d.h. der Teilchenstrahl ist achsparallel zu versetzen. Aus diesem Grunde empfiehlt sich das Ablenkssystem aus zwei in Richtung des Teilchenstrahles hintereinander angeordneten Elementen aufzubauen, die in zwei gegensätzliche Richtungen ablenken, d.h. der Strahl wird im ersten Element von der optischen Achse weg ausgelenkt und im zweiten Element achsparallel ausgerichtet. Hierbei ist die räumliche Anordnung der Elemente zueinander und zur Zylinderlinse grundsätzlich beliebig. Eine einfache bauliche Realisierung könnte darin bestehen, im Eingangsbereich der Zylinderlinse das zweite Element durch Anbringung eines Dipoles anzuordnen. Wichtig ist, bei unterschiedlichen Ablenkungen die Paraxialität des Strahles zu gewährleisten. Im allgemeinsten Fall ist die Frage der Umsetzung der Ablenkung, sei es durch elektrische oder magnetische

Felder, grundsätzlich beliebig.

5 Im Hinblick auf das der Linsenordnung vorgeschalteten Ablenkensystem wird eine Realisierung als bevorzugt angesehen, in der neben einem statischen magnetischen ein zweites in Richtung des Strahlenganges vorgeschaltetes zeitlich verändertes Magnetfeld vorgesehen wird. Durch unterschiedliche Beaufschlagung des letzteren wird der Teilchenstrahl
10 achsparallel in Richtung des Spaltes der Zylinderlinse verschoben.

15 Von Vorteil ist, die Formung des Polschuhs des statischen Magnetfeldes so zu wählen, daß unabhängig von der Ablenkung des austretenden Teilchenstromes durch das vorgeschaltete Magnetfeld stets Paraxialität zum einfallenden Teilchenstrom erzeugt wird.

20 Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale der Erfindung lassen sich dem nachfolgenden Beschreibungsteil entnehmen, in dem anhand der Zeichnung ein Ausführungsbeispiel der Erfindung näher erläutert ist. Es zeigen:

25

Figur 1: ein in schematischer Darstellung gehaltenes Blockschaltbild der erfindungsgemäßen Linsenordnung

30 **Figur 2:** N Anordnungen in Richtung des Spaltes der Zylinderlinse nebeneinander.

Die in Figur 1 widergegebene Linsenordnung läßt

sich in ihrem grundsätzlichen Aufbau in drei Bereichen unterteilen:

Der Teilchenstrom geht aus von Elementen, die die geladenen Teilchen, z. B. die Elektronen, erzeugen - dies geschieht im Element 1 - und anschließend zur Erzeugung eines Strahles fokussieren (Element 2). Dabei ist die einen gekrümmten Verlauf zeigende optische Achse (3) in strich-punktierter Linienführung widergegeben.

Nach dem Bereich der Teilchenerzeugung schließt sich der der Ablenkung an, welcher in Richtung des Strahlenganges aus einem ersten Magnetfeld (4) und einem sich daran anschließenden zweiten Magnetfeld (5) zusammensetzt, wobei im ersten Feld (4) durch Veränderung der Magnetfeldstärke eine unterschiedliche Abblenkung erzeugt wird und durch das weitere, jedoch statische Magnetfeld (5) eine im wesentlichen paraxiale Ausrichtung des Teilchenstromes erfolgt. Im Ergebnis erhält man aufgrund des Ablensystemes (4, 5) einen in seinem Abstand zur Mittelachse einstellbaren paraxialen Versatz. Die eigentliche Abbildung erfolgt im letzten Bereich, der aus einer Zylinderlinse (6) mit einer als Kammlinse ausgebildeten Mittelelektrode (7) aufgebaut ist. Durch sukzessives Beaufschlagen der

einzelnen Elektroden mit einer Spannung geeigneten Größe läßt sich an unterschiedlichen Stellen ein Quadrupolfeld erzeugen. Die Ansteuerung hat derart zu erfolgen, daß im Auftreffpunkt des Teilchenstrahles ein Quadrupolfeld erregt wird mit einer solchen Stärke, daß eine Fokussierung des in Richtung des Spaltes verlaufenden Ebene auf den Bildpunkt eintritt und in der senkrecht hierzu verlau-

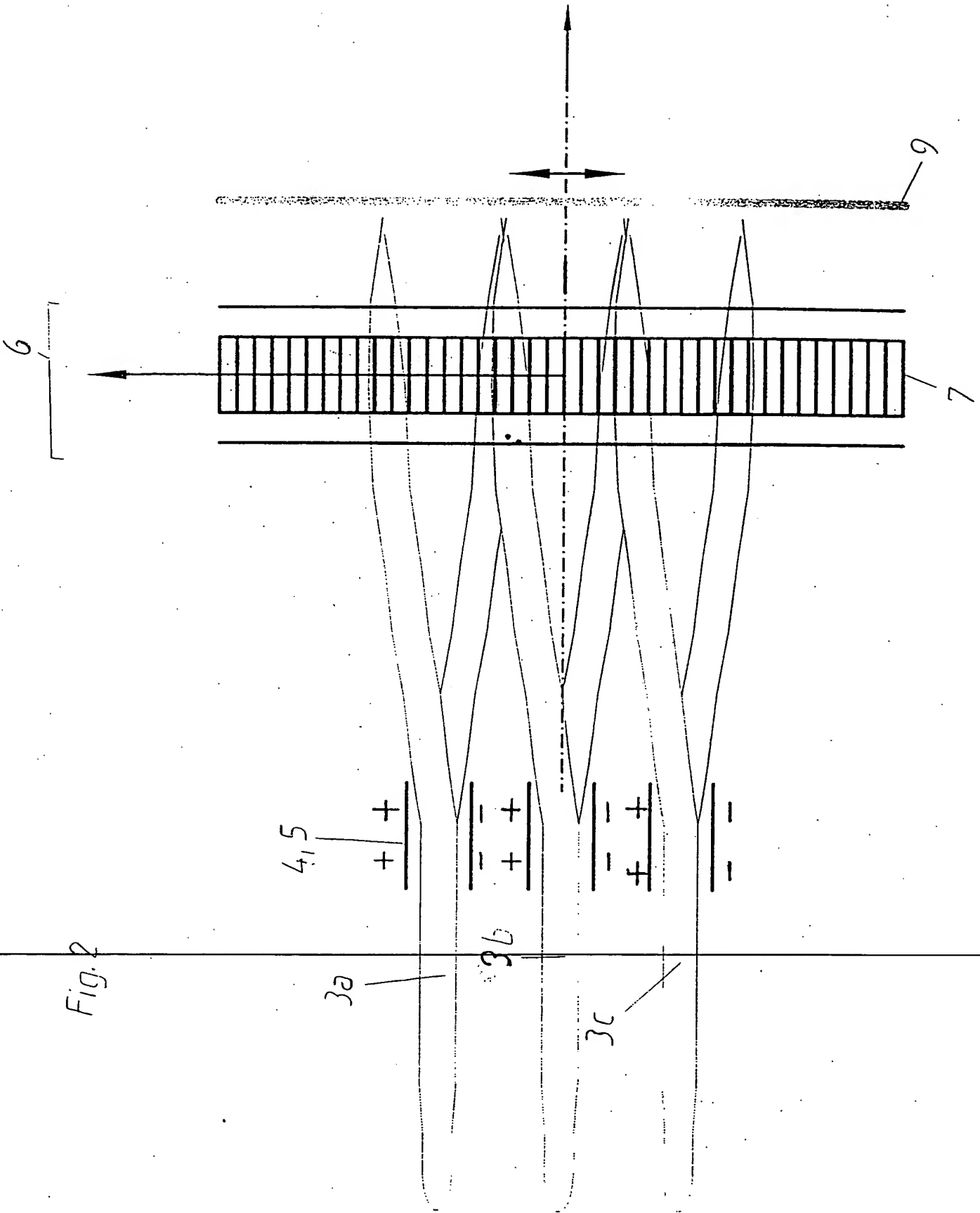
fenden Ebene aufgrund der Überlagerung des Feldes von Zylinderlinse und Quadrupol und geeigneter Einstellung des Zylinderfeldes ebenfalls eine Fokussierung auf demselben Bildpunkt stattfindet, so daß eine stigmatische Abbildung vorliegt. Durch sukzessives Ablenken des Teilchenstromes und entsprechendes Verschieben des Quadrupolfeldes wird in einer sich über die gesamte Breite des Spaltes erstreckenden Gerade eine stigmatische Abbildung möglich. Um das flächenhafte Beschreiben des mit "Wafer" bezeichneten Objektes (9) zu erhalten, muß dieser in einer senkrecht zur optischen Achse verlaufenden Ebene und zwar senkrecht zur Richtung des Spaltes verschoben werden. Im Vergleich zum Stand der Technik ist nunmehr eine eindimensionale und relativ langsame Verschiebung des Objektes vonnöten.

Figur 2 zeigt eine Linsenordnung mit drei parallel zueinander angeordneten Vorrichtungen vorbeschriebener Art. Eingezeichnet sind drei Bündel (3a, 3b, 3c), die durch ein als Kondensator charakterisiertes Ablensystem (4, 5) in Richtung des Spaltes der Zylinderlinse (6) verschoben wird. Dabei schließen sich die Felder aneinander an. Die Zylinderlinse (6) besteht aus einer kammartigen

Mittelelektrode (7), die sukzessive und individuell zur Erzeugung von Quadrupolfeldern beaufschlagt werden. Im Gegensatz zu der in Figur 1 beschriebenen Anordnung ist der Teilchenstrom gegen die optische Achse durch die Zylinderlinsenordnung hindurch leicht geneigt. In bekannter Weise trifft der Teilchenstrom dann auf das als Wafer bezeichnete Objekt (9) auf. Im Ergebnis erhält man ein be-

5 schreibbares Bildfeld, das bei N Anordnungen ein Bildfeld ergibt, daß das N-fache des Scanbereiches einer einzigen Linsenanordnung entspricht. Eine weitere Vergrößerung des Bildfeldes in Richtung des Spaltes der Zylinderlinse ist das Resultat.

Fig. 2



THIS PAGE BLANK (USPTO)